特 集 協奏的量子ビーム研究の最前線 ―蓄電池・ソフトマター―

中性子と放射光の相補的利用によるポリマーブラシ の埋もれた界面構造評価

高原 淳

九州大学ネガティブエミッションテクノロジー研究センター 〒819-0395 福岡市西区元岡744

檜垣勇次

大分大学理工学部共創理工学科 〒870-1192 大分市旦野原700

要旨

基板上に固定した親水性のカチオン型(PMTA-CI),双性イオン型(PMAPS, PMPC),疎水性のフルオロアルキル型(PFAC₈)ポリマーブラシの埋もれた界面の構造を,中性子反射率測定と放射光 X 線分光・散乱測定を相補的に利用して明らかにした。

1. はじめに

材料表面を有機単分子膜や高分子薄膜で被覆すると,濡 れ性,防汚性,潤滑性などが改質されることは1930年代 から知られている。固体表面に高分子鎖を化学結合,ある いは分子間相互作用により固定化(グラフト)することで 得られる「ポリマーブラシ」薄膜は,高分子鎖の性質が表 面特性に直接反映されるため材料表面の改質手法として用 いられることが多い。最近では,親水性高分子がグラフト された親水性ポリマーブラシ薄膜の水溶液中における高度 な防汚性,生体適合性,低摩擦性が明らかとなっており, 新たな機能性薄膜として期待されている。ポリマーブラシ 薄膜の界面特性を理解する上で,その液体界面における構 造の解明が不可欠であるが,固液界面に存在するポリマー ブラシ薄膜の構造解析は極めて困難である。

固体基板表面上にグラフトされたポリマーブラシ鎖の形 態は、1 nm² あたりの高分子鎖の占める割合(グラフト密 度 σ)に応じて変化する。グラフト密度が低い場合(σ < 0.01 chains nm⁻²)は、隣接するポリマーブラシ鎖間に相 互作用が働かず、ポリマーブラシ鎖は3次元方向に拡が るため、分子鎖結合点間距離は希薄溶液中で孤立鎖として 存在する高分子鎖の回転半径の2倍に近い値となり、マ ッシュルーム型の分子鎖形態をとる。グラフト密度が準希 薄状態である場合 $(0.01 < \sigma < 0.1 \text{ chains nm}^{-2})$ は、隣接 するポリマーブラシ鎖同士に相互作用が働くためポリマー ブラシ鎖は基板から垂直方向に伸長した準希薄ブラシ構造 を形成する。グラフト密度が高い場合 ($\sigma > 0.1$ chains nm⁻²)は、ポリマーブラシ鎖間に高い浸透圧が働くため ポリマーブラシ鎖は垂直方向に伸長し、膜厚は高分子鎖の 経路長に相当する厚みとなり、極めて高い圧縮弾性率を示 す濃厚ブラシ構造を形成する1)。しかしながら、溶媒中に おけるポリマーブラシの分子鎖形態は未解明の部分が多い。

小角X線散乱(SAXS)はX線を試料に入射し,散乱 されたX線強度の散乱角度依存性から散乱体の構造を測 定する手法であり,溶液中に分散した孤立高分子鎖,高分 子集合体や微粒子のサイズや形態の測定に有用であ る²⁻⁴⁾。希薄試料で粒子間干渉効果を考慮しなくてよい場 合には,それぞれの粒子からの散乱強度の足し合わせが観 測される散乱強度となる。したがって,散乱体の大きさや 形状が揃っている場合には散乱関数でフィッティングする ことで散乱体の構造情報が得られる。比較的分子鎖長の揃 ったポリマーブラシを粒径分布の小さいナノ粒子にグラフ トしたポリマーブラシグラフト化ナノ粒子の SAXS 測定 結果を解析することで,粒子表面の分子鎖の液体界面での 構造を評価することが出来る。

中性子線や X線は、物質の表面で反射する。表面が平 滑であればよく反射するが、表面に凹凸があると散乱や屈 折のため反射は弱くなる。これは、光の反射と同じであ る。例えば、シリコンウエハなどの平滑固体基板表面に調 製した高分子薄膜に中性子線あるいはX線を入射し、入 射角と反射角が同じ角度になる対称反射の条件で反射され た中性子線あるいはX線の強度を測定する。この場合, 薄膜表面からの反射と、膜と基板の界面からの反射が干渉 するため、入射角の関数として反射率(反射強度/入射強 度)の振動が観測される。この反射率の入射角(あるいは 散乱ベクトル)依存性を解析することで,膜の厚さ,界面 の粗さ、膜厚方向の組成分布などを明らかにすることがで きる5-7)。反射率で物質の表面・界面構造を解析する方法 が反射率測定法であり、X線をプローブに用いる場合を X線反射率測定法(X-ray Reflectivity: XR),中性子線を プローブに用いる場合を中性子反射率測定法(Neutron Reflectivity: NR)とよぶ。中性子は軽元素や磁性体に対 する感度が高く,X線に比べて水素に関する情報を選択 的に識別する能力が高いため、水素を重水素に置換可能な

放射光 Nov. 2021 Vol.34 No.6 297

有機高分子薄膜の構造解析で有用である。また,基板に中 性子透過性の高いシリコンなどを用いて,基板側から中性 子線を入射し,重水素化溶媒を用いることで,ソフトマテ リアル薄膜/水界面などの「ソフト界面」の構造解析が可 能となる。

放射光施設の様々なエネルギー領域のX線を用いるこ とにより、散乱、反射だけでなくX線の吸収・発光・光 電子分光測定が可能である。軟X線を物質に照射する と, 軽元素の内殻電子や重元素の外殻電子と相互作用す る。軟X線の吸収により内殻電子が非占有軌道(伝導帯) または真空準位へ遷移する過程を観測するのが軟X線吸 収分光法 (SXAS: Soft X-ray absorption spectroscopy) で ある⁸⁾。入射X線のエネルギーが結合エネルギーよりも十 分に大きい場合,X線は吸収されて(光電吸収)電子は 真空準位まで到達し束縛状態から解放されて物質の外へ放 出される。この電子を光電子とよび、これをとらえる分光 法が X 線光電子分光法 (XPS: X-ray photoelectron spectroscopy) である。XPS からは、光電子の放出元である 占有軌道の情報を引き出すことができる。光電吸収で内殻 電子が光電子として放出されたあとに空孔が残るが、これ は不安定な励起状態である。この励起状態の緩和過程とし て,X線(特性X線または蛍光X線)を放射する過程と, 電子を放出する過程がある。前者のX線を利用する分光 法が X 線発光分光法(XES: X-ray emission spectroscopy) である。これらの分光法から着目する原子の電子状態に関 する情報を得ることができる。これらの手法は原田らによ り水の構造解析研究に応用され、水の水素結合状態が明ら

かにされている⁹⁾。

Fig. 1に本研究の概要を示す。親水性のカチオン型モノマー(MTA-Cl),双性イオン型モノマー(MAPS,MPC),疎水性のフルオロアルキル型モノマー(FAC₈)を原子移動リビングラジカル重合(ATRP)で重合して,ホモポリマー,シリカナノ粒子上のポリマーブラシ,シリコンウエハ基板上のポリマーブラシを調製し,中性子反射率測定と放射光X線分光・散乱測定を相補的に利用して「ポリマーブラシ」薄膜の界面における構造を解析した研究を以下に紹介する。

小角 X 線散乱による電解質ポリマー ブラシの構造評価

四級アンモニウムカチオンとスルホン酸アニオンで構成 されるスルホベタイン構造を含むポリ[3-(N-メタクリロ イルオキシ-N,N-ジメチル)アンモネートプロパンスルホ ネート](PMAPS)は、スルホベタイン基の強い双極子 に起因する会合により室温で純水に不溶である。水溶液の NaCl 濃度の増加とともにイオン凝集による静電遮蔽によ ってスルホベタイン基の会合による高分子鎖の静電的な凝 集が解消されるため、PMAPSは水溶液に溶解する。一 方、四級アンモニウムカチオンとリン酸アニオンで構成さ れるホスホリルコリン構造を含むポリ(2-メタクリロイ ルオキシエチルホスホリルコリン)(PMPC)は純水、 NaCl 水溶液がともに良溶媒であり、電解質濃度に依らず 拡がった分子鎖形態をとる。本節では、単分散シリカナノ





粒子表面上に PMAPS 鎖あるいは PMPC 鎖をグラフト化 した PMAPS ブラシグラフト化シリカナノ粒子, PMPC ブラシグラフト化シリカナノ粒子の形態を SAXS により 解析し, PMAPS ブラシ, PMPC ブラシの分子鎖形態に 及ぼす NaCl 濃度の影響を研究した事例を紹介する^{10,11)}。

試料として ATRP 開始剤を固定化したシリカナノ粒子 (SiNP, 粒子直径:~110 nm)表面上に PMAPS 鎖(M_n =2.38×10⁴, M_w/M_n =1.27, グラフト密度0.129 chains/ nm²)をグラフトしたシリカナノ粒子(SiNP-PMAPS) とシリカナノ粒子表面上に PMPC 鎖(M_n =2.09×10⁴, M_w/M_n =1.72, グラフト密度0.065 chains/nm²)をグラフ トしたシリカナノ粒子(SiNP-PMPC)を用いた。それら の NaCl 水溶液の SAXS 測定を SPring-8 BL03XU および BL40B2 にて行った。

Fig. 2は,電解質濃度(C_s) 0.50 M および 5.0 M の NaCl 水溶液中における SiNP-PMAPS と SiNP-PMPC の SAXS プロファイルである。散乱ベクトルqは, $q=4\pi$ sin θ/λ と定義した。ここで、2 θ は散乱角、 λ は X 線波長 である。SiNP-PMAPS は、ポリマーブラシ層の存在によ って SiNP とは異なる散乱プロファイルを示した。また、 C_s の増加にともない PMAPS ブラシが膨潤するため、散 乱ピークが僅かに低q 側へシフトした。一方、SiNP-PMPC では C_s の変化にともなう散乱プロファイルの変化 は観測されなかった。SAXS プロファイルからシェルの 厚みを算出するには、一般的にシェル部分の電子密度を一 定とするコアーシェルモデルが使用される。すなわち、コ アーシェルモデルでは分子鎖形態(分子鎖密度分布)は無 視される。しかしながら、ポリマーブラシ鎖は SiNP 表面 上に高密度にグラフトされており、SiNP 表面近傍では PMAPS 鎖が引き伸ばされた濃厚ブラシ構造、外縁部では コイル状形態をとるため、シェル部分の分子鎖形態を無視 することは適切ではない。そこで、Schulz 分布を仮定し たコアと排除体積(自己回避)鎖の相互作用を考慮したシ ェルから成る Pedersen のコアーシェルモデルを適用し、 ポリマーブラシの回転半径を評価した¹²⁾。

Fig. 3は、シリカナノ粒子表面上に固定化した PMAPS ブラシ鎖と PMPC ブラシ鎖の拡がり(s)の塩濃度依存性 の模式図である。PMAPS ブラシのsは、希薄溶液中に孤 立鎖として存在する PMAPS 鎖の回転半径の C_s 依存性と 同様に、 C_s の増加とともに増大した。一方、PMPC ブラ シのsは、希薄溶液中に孤立鎖として存在する PMPC の C_s 依存性と同様に、 C_s が増加しても一定であった¹³⁾。こ のように側鎖の双性イオン基の相互作用の違いにより分子 鎖の拡がりの塩濃度依存性が観測された。



Fig. 2 (Color online) SAXS profiles of SiNP–PMAPS and SiNP–PMPC in the aqueous NaCl solutions at $C_s = 0.50$ and 5.0 M. The solid curves represent the theoretical curves calculated by the core-shell model taking into account the interacting excluded-volume chains and assuming the Schulz-distributed core. [Reproduced from Figures 6, 7 in Ref. 10.]



Fig. 3 (Color online) (A) Schematic cross-sectional cartoon of grafted chains of PMAPS and PMPC on SiNP and (B) the salt concentration dependence of *s*. [Reproduced from Figure 8 in Ref. 10.]

3. 中性子反射率測定によるポリマーブラシ の溶液界面における分子鎖形態評価

NR 測定は、薄膜における鉛直方向散乱長密度分布の非 破壊計測を実現できる手法であり、散乱長密度(SLD), 膜厚,層厚,界面粗さを定量的に明らかにするうえで、極 めて有効な手法である。特に重水素ラベリングを適用する ことで、軽元素からなる薄膜の構造解析に威力を発揮す る。本節では、NR 測定によるシリコンウェハ基板上に PMAPS 鎖あるいは PMPC 鎖をグラフト化した PMAPS ブラシ、PMPC ブラシの分子鎖形態の解析、PMAPS ブ ラシ、PMPC ブラシの分子鎖形態に及ぼす NaCl 濃度の影 響に関する研究について示す¹⁴⁻²⁰⁾。

NR 測定は, J-PARC MLF BL16 SOFIA にて行っ た^{21,22)}。**Fig. 4**に SOFIA の測定系の模式図を示す。25 Hz 白色パルス中性子をディスクチョッパーで遮蔽することで 中性子線の波長(λ)を0.2-0.88 nm に調整し,2次元シ ンチレーションカウンター検出器により Time-of-flight 測定を行った。重水溶液中での測定は,自作液中測定セル を用いてポリマーブラシ薄膜と水溶液を接触させた状態で 密閉し,シリコンウエハ基板側から中性子線を入射して反 射率を測定した。得られた反射率データを解析ソフトウェ ア MOTOFIT でフィッティングし,SLD プロファイルを 得た。散乱ベクトル *q* は, *q*=4 π sin θ/λ と定義した。こ こで, θ は反射角である。

Fig. 5 は側鎖に四級アンモニウム塩構造を含むカチオン 性高分子電解質であるポリ[2-(メタクリロイルオキシ) エチル]トリメチルアンモニウム塩化物塩 (PMTA-Cl) のポリマーブラシの重水および NaCl 重水溶液界面におけ る NR 曲線 [Fig. 5(A)]と、フィッティングにより得られ た鉛直方向の SLD プロファイル [Fig. 5(B)]である¹⁶⁾。 重水中における PMTA-Cl ブラシの膨潤膜厚は175 nm で あり、NaCl 重水溶液中では膨潤膜厚は C_s とともに低下し た。水溶液のイオン強度が増大することでカチオンへのイ オン凝集により静電斥力が低減し、比較的伸長していた分 子鎖が収縮した形態へ変化したためであると考えられる。 また、重水中で膨潤状態にある PMTA-Cl ブラシの密度 分布は一様でなく、基板界面近傍に高密度層、水界面に散 漫な低密度層を形成していることが明らかになった。

対イオンは高分子電解質の分子鎖の拡がりに大きな影響 を及ぼす。塩化物イオン(Cl-)を対イオンとする PMTA-Clブラシ、チオシアン酸イオン(SCN-)を対イ オンとする PMTA-SCN ブラシの、乾燥膜と重水浸漬膜 のNR曲線と、SLD プロファイルから算出した体積分率 プロファイルを Fig. 6 に示す¹⁷⁾。乾燥膜では、PMTA-Cl ブラシ膜、PMTA-SCN ブラシ膜ともに、NR 曲線に明瞭 な Kiessig フリンジが観測され、同様のプロファイルを示 した [Fig. 6(A)]。乾燥状態では、高分子電解質鎖が凝集 して平坦となり、対アニオンは分子鎖のアンモニウムカチ オンとイオン対を形成するため、分子鎖形態に対イオン特 異性が発現していない。一方、重水浸漬膜において、いず れの薄膜でも Kiessig フリンジが著しく減衰した [Fig. 6 (B)]。また、PMTA-Cl ブラシではフリンジが見かけ上消 失したのに対し、PMTA-SCN ブラシではフリンジがわ



Fig. 4 (Color online) Schematic representation of neutron reflectometer SOFIA.



Fig. 5 (Color online) (A) NR profiles of PMTA-Cl brush/D₂O containing 0, 100, 1000 mM NaCl, and (B) their corresponding volume fraction profiles of PMTA-Cl along with the distance from substrate surface. [Reproduced from Figure 4 in Ref. 16.]

ずかに観測された。フリンジの減衰は膜厚の不均一性に起 因しており, PMTA-SCN ブラシでは PMTA-Cl ブラシ よりも膜厚の不均一性が低減していることを示唆してい る。体積分率プロファイルより評価した膨潤膜厚は, PMTA-Cl ブラシが38.7 nm, PMTA-SCN ブラシが27.1 nm であり, PMTA-Cl ブラシの膨潤度が高い。すなわち, SCN⁻アニオンはPMTAブラシの水和膨潤の抑制と, PMTA-SCN ブラシ/重水界面厚の減少を誘導すると考え られる。さらに、基板界面層の SLD は、PMTA-Cl ブラ シ膜よりも PMTA-SCN ブラシ膜の方が高い。このこと は、重水界面層とは逆に、SCN-アニオンが低膨潤度基板 界面層の膨潤度を増大させるように作用していることを示 唆している。構造破壊イオンである SCN⁻ アニオンは Cl-アニオンと比較して水和水の水素結合ネットワークが 乱れており,弱く水和している²³⁾。そのため PMTA ブラ シ鎖のアンモニウムカチオンと相対的に強く相互作用する ため PMTA ブラシ鎖の親水性が低下し水和が抑制されて いると考えられる。

一方,双性イオンポリマーブラシでは正負両電荷を持つ 双性イオンの相互作用により,電解質ポリマーブラシとは 異なる挙動を示す。Fig.7は重水溶液中における PMAPS ブラシ膜の NR プロファイルと SLD プロファイルであ る¹⁶⁾。電解質を含まない重水中において,PMAPS ブラシ は水和膨潤するものの SLD の異なる2層で構成され,そ の重水界面の界面厚は高分子電解質膜と比較して薄い。 PMAPS 鎖はスルホベタインの双極子に起因する相互作用 により水中において凝集するため,PMAPS ブラシはネッ トワーク状の膨潤膜を形成しており,カチオン性高分子電 解質膜ほど散漫な界面を形成していない。さらに,膜厚方 向の面内分子鎖密度に応じてスルホベタインの会合度に傾 斜が生じるため,膨潤度の異なるに2層構造を形成した と考えられる。NaCl重水溶液中では C_sの増大とともに NR プロファイルにおける Kiessing フリンジの減衰が観 測された。SLD プロファイルにおいて,膨潤 PMAPS ブ ラシ層における SLD が増大し,重水界面厚が増大した。 PMAPS ブラシの水和状態は共存するイオン種,スルホベ タイン基の電荷間スペーサ長によっても多様に変化するこ とが確認されている^{18,19}。

同じ双性イオンでもリン脂質の極性基であるホスホリル コリン基を双性イオン基に有する PMPC ブラシ鎖は電解 質存在下でも収縮せず,ほぼ伸びきり鎖の状態を維持して いることが NR 測定から明らかとなった¹⁶⁾。 PMPC は生 体細胞膜表面のリン脂質極性基に着目して設計された生体 適合性電解質ポリマーであり,ホスホリルコリン基間の弱 い静電相互作用と特異な水和構造が塩濃度非依存性の要因 と考えられている。

PMPC は水,エタノールに溶解するが,水とエタノー ルの混合溶媒には不溶化する共貧溶媒効果を示す。共貧溶



Fig. 6 (Color online) NR curves of (a) the PMTA-Cl brush and (b) the PMTA-SCN brush in (A) dry nitrogen atmosphere at 298 K and (B) salt-free D₂O at 298 K. The black solid lines are the fitting curves. NR intensities are offset by two decades for the sake of clarity. (C) Polymer volume fraction profiles for (a) the PMTA-Cl brush (red line) and (b) the PMTA-SCN brush (blue line) in salt-free D₂O. [Reproduced from Figures 5, S4 in Ref. 17.]

媒効果は,混合溶媒におけるクラスター形成や分子鎖の選 択的溶媒和,水素結合の競合などが発現機構として提案さ れているものの,解明されていない。重水素化率の異なる 混合溶媒を用いたコントラスト変調 NR 測定により,共 貧溶媒効果により凝集した PMPC ブラシに含まれる混合 溶媒の組成を明らかにすることで,共貧溶媒効果発現機構 の解明を試みた²⁰⁾。Fig. 8 は D₂O/C₂D₅OD 混合溶媒中にお ける PMPC ブラシの NR 曲線と SLD プロファイルであ る。D₂O, C₂D₅OD 中では NR 曲線に明瞭なフリンジは観 測されず, PMPC ブラシは高度に膨潤した形態であっ た。一方, C₂D₅OD 体積分率0.7~0.95の D₂O/C₂D₅OD 混

合溶媒中では Kiessig フリンジが観測され、膨潤 PMPC ブラシの SLD が低下した。すなわち, PMPC ブラシは共 貧溶媒効果により凝集した。H2O/C2D5OH 混合溶媒中に おいても, PMPC ブラシは同様の共貧溶媒効果による凝 集を示したが、混合溶媒の重水素化率が異なるため膨潤層 の SLD は異なる。D₂O/C₂D₅OD 混合溶媒,H₂O/C₂D₅OH 混合溶媒中における PMPC ブラシ膨潤層の SLD より膨 潤層に含まれる水とエタノールの組成を算出したところ, 共貧溶媒効果により凝集した PMPC ブラシ層内部の溶媒 組成は、媒質である混合溶媒と比較して水分率が高いこと が明らかとなった。競争的水素結合と協同的溶媒和に基づ く統計力学モデルシミュレーションによると、凝集した PMPC 鎖近傍では溶媒和する水とエタノールの体積が同 等になる。したがって, 共貧溶媒効果により凝集した PMPC ブラシ層が相対的に多くの水を含む結果より, 競 争的水素結合と協同的溶媒和に基づく共貧溶媒効果の分子 機構の妥当性が示された。

4. 軟×線分光を用いた電解質ポリマーブラシ に閉じ込められた水の水素結合状態の評価

SAXS 測定, NR 測定で示されたように電解質ポリマー ブラシは,水中において高度に水和して膨潤する。高分子 電解質鎖が基板表面に高密度に固定化された電解質ポリ マーブラシでは高分子電解質が強制的に基板界面に局在化 しており、その水和水は高濃度の高分子電解質に閉じ込め られた状態であるため、バルク水とは異なる水素結合状態 であることが推測される。膨潤した電解質ポリマーブラシ に含まれる水の水素結合構造を明らかにするために、軟 X線吸収・発光分光測定を用いてカチオン性高分子であ る PMTA-Cl ブラシ膜に閉じ込められた水の水素結合に 関与する電子状態を測定した²⁴⁾。表面開始ATRPによ り、金コートした SiC 基板にカチオン性高分子電解質で ある PMTA-Cl ブラシを調製した。XAS・XES 測定は, 軟X線を大気圧下の液体試料に直接照射できる溶液フ ローセルを用いて、SPring-8 東京大学アウトステーショ ンビームライン BL07LSU の超高分解能軟 X 線発光分光 装置にて行った。Fig.9に実験系の模式図を示す。Fig.10 は PMTA-Cl ブラシの水蒸気雰囲気での軟 X 線発光分光 スペクトルである。PMTA-Cl ブラシに閉じ込められた水 のスペクトルは、四面体配位した水素結合を示す1b1'の ピークのみを有し、水が基本的にすべて水素結合でつなが れていることが示唆された。また,水素結合の歪みの程度 を示す 3a1 のピークがバルク水と比較して強くなっている ことから、その水素結合ネットワークがわずかに歪んでい ることも示唆された。



Fig. 7 (Color online) (A) NR profiles of PMAPS brush/D₂O containing 0, 100, 1000 mM NaCl, and (B) their corresponding volume fraction profiles of PMAPS along with the distance from substrate surface. [Reproduced from Figure 5 in Ref. 16.]



Fig. 8 (Color online) (A) Neutron reflectivity of PMPC brush in D_2O/C_2D_5OD mixed solvent and (B) their corresponding neutron SLD profiles along with the distance from substrate surface. [Reproduced from Figure 2 in Ref. 20.]



Fig. 9 (Color online) Schematic of the experimental setup for the XES of water confined in the PMTA-Cl brush. [Reproduced from Figure 3S in Ref. 24.]



Fig. 10 (Color online) O 1s soft X-ray emission spectra of water confined in the PMTA-Cl brush, liquid H₂O, and ice I_h. The excitation energy is 550.3 eV, which is well above the ionization threshold. [Reproduced from Figure 3 in Ref. 24.]

5. ポリフルオロアクリレート (PFAC₈) ブ ラシの超臨界二酸化炭素中での膨潤挙動

超臨界二酸化炭素は環境に優しいグリーンな溶媒として 着目されている。特にフッ素系高分子は超臨界二酸化炭素 と強く相互作用することが知られている。超臨界二酸化炭 素雰囲気下におけるポリフルオロオクチルエチルアクリ レート(PFAC₈)の膨潤状態を解明するため,PFAC₈ブ ラシの超臨界二酸化炭素雰囲気下における NR 測定を行 った²⁵⁾。なおフッ素は散乱長密度が高いため重水素によ るラベル化が不要である。

Fig. 11(A)に二酸化炭素雰囲気下にあるポリマーブラシ のNR 測定の概略図を示す。反射率計はアメリカNIST のNG-7反射率計を用いた。シリコン基板側からCO₂ 雰 囲気下にあるPFAC₈ブラシに中性子線を照射し,反射し た中性子をシンチレーション検出器で計測した。Fig. 11 (B)は種々の圧力条件におけるCO₂中のPFAC₈ブラシの NR 曲線である。図中の実線は,Fig. 11(C)のPFAC₈ブラ シ鎖の体積分率プロファイルから計算された反射率曲線で ある。シリコン基板上に調製したPFAC₈ブラシのフルオ ロアルキル側鎖は結晶化する²⁶⁾。超臨界二酸化炭素は PFAC₈の溶媒として働くため圧力が高くなり超臨界状態



Fig. 11 (A) Schematic configuration of the high-pressure NR experiments for the $PFAC_8$ brush films. (B) NR profiles (circles) for the $PFAC_8$ brush thin film at different CO_2 pressures. Consecutive reflectivity curves have been offset from each other for clarity. The solid lines correspond to the calculated reflectivity curves based on the volume fraction profiles of the $PFAC_8$ brush thin film shown in (C). [Reproduced from Figure 1 in Ref. 25.]

となると、実験結果よりフリンジの間隔が狭くなり、 PFAC₈ブラシが膨潤する。PFAC₈ブラシの膜厚は、乾燥 状態の60 nm から P = 8.2 MPa で120 nm に増加し、さら に P = 13.8 MPa で 150 nm に達することが明らかになっ た。圧力を13.8 MPa に上げると、膨潤した PFAC₈ブラ シの放物線状の界面構造のためにフリンジが消失しており、 P = 13.8 MPa では CO₂ が PFAC₈ の良溶媒となっている ことを示している。このように NR 測定により超臨界流 体中での高分子鎖の膨潤状態が明らかとなった。

6. おわりに

放射光 X 線を利用した SAXS 測定, XES 測定と, 中性 子線を利用した NR 測定の相補利用により,液体界面に おけるポリマーブラシ膜の膨潤状態,密度分布,界面厚, 膨潤溶媒組成や水の水素結合状態を総合的に評価すること が可能となり,それらの結果に基づき液体に埋もれたポリ マーブラシの描像を明らかにした。親水性ポリマーブラシ の生体適合性,防汚性や潤滑性の分子論的発現機構を理解 する上で,湿潤環境下における分子鎖の実態は重要な情報 となる。硬 X 線,軟 X 線,中性子線などの量子ビームの 相補利用によるポリマーブラシの構造,構成する物質の電 子状態やダイナミクス,それらの経時変化など,詳細な実 態の解明により高度なソフト界面設計が可能となると期待 される。

謝辞

本研究の一部は JST/ERATO 高原ソフト界面プロジェ クト,文部科学省光・量子融合連携研究開発プログラムに よる援助を受けたものである。中性子反射率測定を実施す るにあたり KEK の山田悟史准教授,XES 測定を実施す るにあたり原田慈久教授(東大物性研)にご支援いただき ました。また共同研究者である鳥飼直也教授(現三重大), 瀬戸秀紀教授(KEK),小林元康教授(現工学院大),古 賀忠典教授(Stony Brook 大),菊地守也博士(現山形大) に深く感謝します。

参考文献

- 辻井敬亘,大野工司,榊原圭太:ポリマーブラシ(共立出版, 2017).
- W. H. de Jeu: Basic X–Ray Scattering for Soft Matter (Oxford, 2016).
- J. Als-Nielsen: Elements of Modern X-ray Physics (Wiley, 2011).
- 4) R.-J. Roe: Methods of X-ray and Neutron Scattering in Polymer Science (Oxford, 2000).
- 5) T. P. Russell: Mater. Sci. Rep. 5, 171 (1990).
- 6) 入門講座「中性子反射率測定」:波紋 18-20 (2008-2010).
- A. Takahara and Y. Higaki: Molecular Soft-Interface Science (Springer, 2019) 129.
- 8) 徳島高, 堀川裕加: 分析化学 64, 237 (2015).

- Y. Harada, J. Miyawaki, H. Niwa, K. Yamazoe, L. G. M. Pettersson and A. Nilsson: J. Phys. Chem. Lett. 8, 5487 (2017).
- 10) M. Kikuchi, Y. Terayama, T. Ishikawa, T. Hoshino, M. Kobayashi, H. Ogawa, H. Masunaga, J. Koike, M. Horigome, K. Ishihara and A. Takahara: Polym. J. 44, 121 (2012).
- 11) 菊地守也,川口正剛,高原淳:色材協会誌 88,341 (2015).
- J. S. Pedersen, C. Svaneborg, K. Almdal, I. W. Hamley and R. N. Young: Macromolecules 36, 416 (2003).
- Y. Matsuda, M. Kobayashi, M. Annaka, K. Ishihara and A. Takahara: Langmuir 24, 8772 (2008).
- M. Kobayashi, Y. Terayama, M. Kikuchi and A. Takahara: Soft Matter 9, 5138 (2013).
- Y. Higaki, M. Kobayashi and A. Takahara: Langmuir 36, 9015 (2020).
- M. Kobayashi, K. Ishihara and A. Takahara: J. Biomater. Sci.: Polym. Ed. 25, 1673 (2014).
- 17) Y. Higaki, Y. Inutsuka, H. Ono, N.L. Yamada, Y. Ikemoto and A. Takahara: Ind. Eng. Chem. Res. 57, 5268 (2018).
- 18) Y. Higaki, Y. Inutsuka, T. Sakamaki, Y. Terayama, A. Takenaka, K. Higaki, N. L. Yamada, T. Moriwaki, Y. Ikemoto and A. Takahara: Langmuir 33, 8404 (2017).

X-ray scattering.

- 19) T. Sakamaki, Y. Inutsuka, K. Igata, K. Higaki, N. L. Yamada, Y. Higaki and A. Takahara: Langmuir 35, 1583 (2019).
- 20) D. Ihara, Y. Higaki, N. L. Yamada, F. Nemoto, Y. Matsuda, K. Kojio and A. Takahara: Langmuir, in press (DOI: 10.1021/acs.langmuir.1c01762).
- 21) N. L. Yamada, N. Torikai, K. Mitamura, H. Sagehashi, S. Sato, H. Seto, T. Sugita, S. Goko, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, T. Fujiwara, H. Takahashi and A. Takahara: Euro. Phys. J. Plus. **126**, 108 (2011).
- 22) K. Mitamura, N. L. Yamada, H. Sagehashi, N. Torikai, H. Arita, M. Terada, M. Kobayashi, S. Sato, H. Seto, S. Goko, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, H. Jinnai and A. Takahara: Polym. J. 45, 100 (2013).
- 23) T. T. Duignan, D. F. Parsons and B. W. Ninham: Chem. Phys. Lett. 608, 55 (2014).
- 24) K. Yamazoe, Y. Higaki, Y. Inutsuka, J. Miyawaki, Y.-T. Cui, A. Takahara and Y. Harada: Langmuir 33, 3954 (2017).
- 25) H. Yamaguchi, P. Gin, H. Arita, M. Kobayashi, S. Bennett, S. K. Satija, M. Asada, T. Koga and A. Takahara: RSC Adv. 3, 4778 (2013).
- 26) H. Yamaguchi, M. Kikuchi, M. Kobayashi, H. Ogawa, H. Masunaga, O. Sakata and A. Takahara: Macromolecules 45, 1509 (2012).



高原 淳 九州大学ネガティブエミッションテクノロ ジー研究センター 特任教授 E-mail: takahara.atsushi.150@m.kyushu -u.ac.jp

専門:高分子科学,高分子表面科学,高分 子の崩壊と安定化 **[略歴]**

1983年九州大学大学院工学研究科博士課 程修了。1983年九州大学工学部・助手。 1985年九州大学工学部・助教授。1999年 九州大学有機化学基礎研究センター・教授。 2003年九州大学先導物質化学研究所・教 授。2021年より現職。



檜垣勇次 大分大学理工学部共創理工学科 准教授 E-mail: y-higaki@oita-u.ac.jp 専門:高分子構造,高分子表面・界面 [略歴]

2006年九州大学大学院工学府博士課程修 了。2006年帝人株式会社。2011年九州大 学先導物質化学研究所・助教。2018年よ り現職。

Characterization of buried interface of polymer brushes by complementary use of neutron and synchrotron radiation X-ray beams

著者紹介

Atsushi TAKAHARA			esearch Center for Negative Emission Technology, Kyushu University, 744 Iotooka, Nishi-ku, Fukuoka 819–0395, JAPAN
Yuji HIG	AKI Facu JAP	lty of S AN	cience and Technology, Oita University, 700 Dannoharu, Oita 870–1192,
Abstract	Buried inter hydrophobi neutron ref	facial sti c fluoroa ectivity,	ructures of hydrophilic cationic (PMTAC), zwitterionic (PMAPS, PMPC), and alkyl (PFAC8) polymer brushes immobilized on the substrate were revealed by synchrotron radiation soft X-ray absorption and emission spectroscopy, and